

WO 2005/065843 A1



MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

**(84) Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

wodurch die Beschichtungsflüssigkeit zu Kapillarwellen angeregt wird, an deren Schwingungsbäuchen sich feinste Beschichtungsmitteltröpfchen abschnüren. Die erfindungsgemäße Hochfrequenzzerstäubungsvorrichtung umfasst ferner einen Substrathalter (8), mit dem das zu beschichtende Substrat (14) während des gesamten Beschichtungsvorgangs in einer für die Beschichtung geeigneten Position gehalten werden kann und anschließend in den Bereich einer Trocknungsvorrichtung (6) bewegt werden kann, wo das frisch beschichtete Substrat (14) getrocknet werden kann. Bevorzugt umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Absaugvorrichtung (10), um das Overspray abzusaugen, eine Vorrichtung zur Temperierung der Auftragskammer oder Teilen der Auftragskammer und/oder der eingesetzten Beschichtungslösungen, sowie ein Anoden- und Polplattensystem zur Erzeugung von Magnetfeldern und/oder elektrostatischen bzw. ionisierenden Feldern zur Beeinflussung der Verteilung von Beschichtungslösungen und/oder der geometrischen Ausrichtung von Partikel-Komponenten solcher Beschichtungslösungen.